

Macchina Di Rivestimento Pecvd Con Evaporazione Potenziata Da Plasma

Numero articolo: KT-PED



introduzione

Potenziare il vostro processo di rivestimento con le apparecchiature di rivestimento PECVD. Ideale per LED, semiconduttori di potenza, MEMS e altro ancora. Deposita film solidi di alta qualità a basse temperature.

[Ulteriori informazioni](#)

Portacampione	Dimensioni	1-6 pollici
	Velocità di rotazione	0-20 giri/minuto regolabile
	Temperatura di riscaldamento	≤800°C
	Precisione di controllo	±0,5°C Regolatore PID SHIMADEN
Spurgo del gas	Misuratore di flusso	CONTROLLORE DEL FLUSSIMETRO DI MASSA (MFC)
	Canali	4 canali
	Metodo di raffreddamento	Raffreddamento ad acqua circolante
Camera a vuoto	Dimensione della camera	Φ500mm X 550mm
	Porta di osservazione	Porta di osservazione completa con deflettore
	Materiale della camera	Acciaio inox 316
	Tipo di porta	Porta ad apertura frontale
	Materiale del tappo	Acciaio inox 304
	Attacco pompa del vuoto	Flangia CF200
	Porta di ingresso del gas	Connettore φ6 VCR
Potenza del plasma	Alimentazione della sorgente	Alimentazione CC o RF
	Modalità di accoppiamento	Accoppiamento induttivo o capacitivo a piastra
	Potenza di uscita	500W-1000W
	Potenza di polarizzazione	500v
Pompa a vuoto	Pre-pompa	15L/S Pompa per vuoto a palette
	Porta della pompa turbo	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	Porta di scarico	KF25
	Velocità della pompa	Pompa a palette: 15L/s □ Pompa turbo: 1200l/s □ 1600l/s
	Grado di vuoto	≤5×10 ⁻⁵ Pa
	Sensore di vuoto	Vuoto a ionizzazione/resistenza/filmometro
Sistema	Alimentazione elettrica	AC 220V /380 50Hz

Potenza nominale	5kW
Dimensioni	900 mm X 820 mm X870 mm
Peso	200 kg